



آقای سعید پهلوان پایان نامه ۹ واحدی خود را با عنوان مدلسازی و آنالیز انتشار پالس های پیکو ثانیه در تقویت کننده نوری نقطه کوانتومی در تاریخ ۱۳۸۹/٤/۱٤ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر – الکترونیک پیشنهاد می کنند.

	[ امضا	رتبه علمی	نام و نام خانوادگی	عضو هيات داوران
	1	استاد	دکتر وحید احمدی	استاد راهنما
1	F	7		1
(		استاد	دكتر محمدكاظم مروج فرشي	استاد ناظر
	S	استاد	دكتر احسان اله كبير	استاد ناظر
	Λ			
	to	دانشيار	دکتر رحیم فائز	استاد ناظر
		استاد	دكتر محمدكاظم مروج فرشي	مدیر گروہ
	20			(یا نماینده گروه تخصصی)

#### آییننامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاستهای پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانشآموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایاننامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده 1- حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده 2- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایاننامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان نامه/ رساله نیز منتشر می شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده 3- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایاننامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین نامه های مصوب انجام شود. ماده 4- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنوارههای ملی، منطقهای و بینالمللی که حاصل نتایج مستخرج از پایاننامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده 5- این آییننامه در 5 ماده و یک تبصره در تاریخ87/4/11 در شورای پژوهشی و در تاریخ 87/4/23 در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ 87/7/15 شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازمالاجرا است.

«ینجانب سعید پهلوان دانشجوی رشته مهندسی برق- الکترونیک ورودی سال تحصیلی 81 مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر متعهد می شوم کلِیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم»

#### آیین نامه چاپ پایاننامه (رساله)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله)های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه،دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند: ماده 1: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله)ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثارعلمی» دانشگاه اطلاع دهد. ماده 2: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند: «کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته است که در سال دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار در دانشکده خانم /جناب آقای دکتر ، مشاوره سرکار خانم *اج*ناب آقای دکتر 9 مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر از آن دفاع شده است.» ماده 3: به منظور جبران بخشی از هزینههای انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبتچاپ) را به «دفتر نشر آثارعلمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه میتواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر درمعرض فروش قرار دهد. ماده 4: در صورت عدم رعایت ماده 3، 50% بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیتمدرس، تأدیه کند. ماده 5: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه میتواند خسارت مذکور را از

طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق میدهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده 4 را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید. ماده 6: اینجانبسعید پهلوان دانشجوی رشتهمهندسی برق - الکترونیک مقطع کارشناسی ارشد تعهد فوق وضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.



دانشکده فنی و مهندسی

پایاننامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق -الکترونیک

مدل سازی و تحلیل انتشار پالس های پیکو ثانیه در تقویت کننده نوری نقطه کوانتومی

سعيد پهلوان

استاد راهنما:

آقاي دكتر وحيد احمدي

**تابستان** 1389

تقدیم به پدر و مادر بزرگوارم که آموختن را ارزشم ساختند...

## تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر با استمداد از بزرگوارانی صورت پذیرفته که تشکر از ایشان را بر خود لازم می دانم. نخست، جناب آقای دکتر وحید احمدی که نظارت دقیق و راهنمایی های دلسوزانه ایشان موجب ارتقاء علمی این پژوهش شد. همچنین، جناب آقای دکتر محمد حسن یاوری که مباحثات طولانی با ایشان موجب هموار تر شدن و

کوتاه تر شدن مسیر انجام پژوهش شد. کوتاه تر شدن مسیر انجام پژوهش شد.

و نیز والدین بزرگوار و خواهر و برادر عزیزم که دست و زبانم از عهده شکرشان بر نمی آید.

### چکیدہ

تقویت کننده های نقطه کوانتومی به دلیل داشتن چگالی حالات به شکل توابع ضربه از کارایی بسیار بهتری نسبت به تقویت کننده های بالک و یا چاه کوانتومی برخوردارند. بعد از ظهور لیزر های نقطه کوانتومی InAs/GaAs خود سامان شونده که طول موج لیزینگ آنها بیشتر از 1.3 میکرومتر است مطالعات بسیاری برای تحقق کارکرد مورد انتظار آنها انجام گرفته است. فیزیک تقویت کننده های نوری نقطه کوانتومی با معادلات نرخ حاکم بر چگالی حامل ها در تراز های پایه، برانگیخته، بالایی، لایه wetting و همچنین چگالی فوتون ها بیان می گردد. برای شبیه سازی تقویت کننده باید دستگاه معادلات دیفرانسیل شامل چند صد معادله که مجهولات آن توأمان به زمان و مکان وابستگی دارند را با

برای شبیه سازی تقویت کننده، طول آن را به چندین قسمت مساوی تقسیم و چگالی حامل ها و فوتون ها را در هر قسمت مستقل از مکان فرض کرده ایم. با تقسیم پالس به تکه های زمانی و حل عددی معادلات در هر قسمت به طور جداگانه قادر به شبیه سازی عبور پالس از تقویت کننده خواهیم بود. نتایج شبیه سازی از تطابق قابل قبولی با نتایج مرجع اصلی این پروژه [29] برخوردار است. در این پروژه عرض پالس ها در محدوده pt 10 pt با توان ماکسیمم در محدوده WmW و چگالی جریان بین <sup>1</sup> kA/cm<sup>2</sup> پالس ها در محدوده to pt با توان ماکسیمم در محدوده to mW و چگالی جریان بین <sup>1</sup> kA/cm<sup>2</sup> تا <sup>1</sup> kA/cm<sup>2</sup> و چگالی جریان بین <sup>1</sup> b kA/cm<sup>2</sup> و پالس ها در محدوده I b kA/cm<sup>2</sup> و غیر تا محدوده محدوده و عال این ماکسیمم در محدوده و معال و پهن شدگی های همگن و غیر سانتی متر تغییر می کند. تأثیر پارامتر های مختلف مانند جریان، دما و پهن شدگی های همگن و غیر همگن بر انتشار پالس مطالعه شده اند. همچنین به دلیل نحوه مدلسازی تقویت کننده، توانستیم تا برای اولین بار انتشار دو سیگنال در تقویت کننده در جهت های یکسان و متفاوت و تأثیر آنها بر یکدیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

كليد واژه: تقويت كننده نورى نقطه كوانتومى، انتشار پالس

فهرست مطالب

فهرست اشكال		
۴	مداول	فهرست ج
۵	مروری بر تحقیقات انجام شده در تقویت کننده های نوری نقطه کوانتومی	فصل ۱-
	مقدمه 5	-1-1
6	رشد نقاط كوانتومي	-2-1
10	ساختار الكترونيكي نقاط كوانتومي	-3-1
14	لیزر ها و تقویت کننده های نقطه کوانتومی	-4-1
16	مزایای استفاده از نقاط کوانتومی	-5-1
18	طراحي پروفايل بهره	-6-1
19	پاسخ فوق سريع بهره	-7-1
20	عرض باند	-8-1
21	كيفيت شكل موج در ناحيه اشباع بهره	-9-1
25	· بازتولید کننده های سیگنال	-10-1
29	عدم حساسیت به قطبش	-11-1
۳۳	فیزیک و ساختار تقویت کننده های نوری نقطه کوانتومی	فصل ۲-
34	ساختار باند انرژی و گروه بندی نقطه های کوانتومی	-1-2
36	معادلات نرخ چگالی حامل ها	-2-2
39	معادلات نرخ چگالی فوتون ها	-3-2
39	محاسبه نرخ های واهلش	-4-2
41	نحوه مدلسازي تقويت كننده	-5-2
۴۵	عبور پالس از تقویت کننده نوری نقطه کوانتومی	فصل ۳-
45	عبور پالس واحد از تقویت کننده نوری نقطه کوانتومی	-1-3
63	شبیه سازی تقویت کننده نوری با دو سیگنال	-2-3
64	-1- انتشار دو سیگنال در جهت یکسان	2-3
69	-2- اعمال سيگنال از دو طرف	2-3
80	ورود پالس ها با اختلاف زمانی	-3-3
٨۵	نتیجه گیری و پیشنهادات	فصل ۴-
85	نتيجه گيرى	-1-4
86	پیشنهادات	-2-4

۸١	۲	فهرست مراجع
٩٠	·	واژه نامه فارسی به انگلیسی
٩٢	,	واژه نامه انگلیسی به فارسی

## فهرست اشكال

ی (سمت راست)	شکل 1-1. نمای ساده ای از چاه کوانتومی (سمت چپ) و سیم کوانتوم
ک است	شکل 2-1. درجه آزادی حرکت حامل ها در سیم های کوانتومی برابر ی
حامل ها برابر صفر است	شکل 3-1. نمای ساده ای از یک نقطه کوانتومی. درجه آزادی حرکت -
چپ) و دیاگرام فازی آنها. محور افقی بر حسب عدم	شکل 4-1. نمای ساده ای از سه مدل رشد VW ،FM و SK (سمت
در نواحی R1، R1 و R3 همان طور که در اشکال	تطابق شبکه و محور عمودی تعداد تک لایه های نشانده شده است. ه
يروى نمى كند [1]8	داخلی نشان داده شده است رشد جزایر ناپایدار است و از نظم خاصی پ
ت) نقاط کوانتومی InP روی GaAs. نقاط ردیف	شکل 5-1. تصاویر TEM از بالا (سمت چپ) و از کنار (سمت راس
شده است در حالیکه نقاط ردیف پایین پس از رشد	بالایی در 500 درجه سانتی گراد رشد داده شده و روی آنها پوشانده
ه شده و در همین دما پوشانده شده اند	در 500 درجه سانتی گراد به مدت 120 ثانیه در 450 درجه نگاه داشت
وانتومی. در قسمت بالایی نقطه کوانتومی و لایه	شکل 6-1. نمای کناری (بالا) و نمودار نوار انرژی (پایین) نقاط ک
حرف B نشان داده شده اند. نوار انرژی بر حسب x	wetting به رنگ تیره و با حرف A و ماده میزبان به رنگ روشن و با
شکل رسم شده است	در امتداد خط چین نشان داده شده در قسمت بالایی در قسمت پایین
12	شکل7-1. ساختار و تابع چگالی حالات چاه،سیم و نقطه کوانتومی
InAs/GaA نشان داده شده در شکل 5-1. خطوط	شکل 8-1. شدت تابش بر حسب انرژی فوتون برای نقاط کوانتومی 🛚
450 درجه و خطوط نقطه چین مربوط به نقاط رشد	کامل مربوط به نقاط رشد داده شده در 500 درجه و پوشانده شده در
13	داده و پوشانده شده در 500 درجه می باشند
15	شکل 9-1. تاریخچه کاهش جریان آستانه لیزرها [10]
InGaAs/C با ساختار موجبر p-i-n	شکل 10-1. شماتیک یک لیزر یا تقویت کننده نقطه کوانتومی JaAs
ل تراز پایه در نظر گرفته شده است	شکل 11-1. نمای بهره محیط نقطه کوانتومی. در این شکل فقط انتقال
می. در سمت راست تفاوت این ساختار ها با ساختار	شکل 12-1. نمایش پاسخ بهره فوق سریع در محیط های نقطه کوانتو
20	های سنتی نمایش داده شده استهای سنتی نمایش داده
می با رنگ روشن بهره بزرگتر از 20 dB، رقم نویز	شکل 13-1. وابستگی بهره، رقم نویز و توان اشباع به طول موج. نوا
ی کنند. این اعداد برای نواحی به رنگ تیره به ترتیب	کوچکتر از dB 7 و توان اشباع بزرگتر از dBm را توأمان فراهم مح
22	برابر 25، 5 و 19 است [20]
22[20]	شکل 14-1. مقایسه عرض باند انواع مختلف تقویت کننده های نوری [
در تقویت کننده های نوری نقطه کوانتومی(بالا) و	شكل 15-1. خصوصيات اشباع بهره و كيفيت شكل موج تقويت شده
23	چاه کوانتومی (پایین)
چاو و نقطه کوانتومی چاو و نقطه کوانتومی	شکل1-16. نرخ خطای بیت و دیاگرام های چشمی برای ساختار های .
24	شكل 17-1. مقايسه توان خروجي انواع مختلف تقويت كننده هاي نور
ینده نوری نقطه کوانتومی (چپ) و چاه کوانتومی	شکل 18-1. فشرده سازی نویز سطح یک با استفاده از تقویت کن
26	(راست)
ر ثانیه (چپ) و سیگنال خروجی تقویت کننده نقطه	شکل 19-1.دیاگرام چشمی سیگنال ورودی با فرکانس 40 گیگابیت بر
ی کننده در B dB اشباع بهره به کار گرفته شده	کوانتومی (وسط) و تقویت کننده چاه کوانتومی (راست). هر دو تقوین
26	
27	شکل 20-1. بهبود عدد Q در تقویت کننده نوری نقطه کوانتومی [21]

شکل 12-1. مشخصات نرخ خطای بیت و بهبود حساسیت گیرنده با به کار گیری تقویت کننده نقطه کوانتومی شكل 22-1. ساختار هاي مختلف سنتي تمام نوري باز توليد كننده ها. از بالا به پايين: 1- اشباع بهره [12] 2- ساختار 28...... ماخ-زندر متقارن [14] 4- ساختار تداخل سنج غيرخطي فوق سريع [15] ............................. شکل 23-1. چپ: دیاگرام چشمی سیگنال 10 گیگا بیت در ثانیه پس از عبور از جذب کننده قابل اشباع که بین 0 و 3 ولت به صورت معكوس باياس شده و تابع انتقال غير خطى تقويت كننده نورى همراه با اين جذب كننده. راست: تغيير حاصل در توزيع نويز اندازه گيري شده در مركز زمان بيت....... شكل I-24. كنترل قطبش بهره با استفاده از روى هم نشانى لايه هاى نقاط كوانتومى InAs روى GaAs 31......[27] شکل 1-25. تابش یکسان دو نوع قطبش در تمامی محدوده طول موج با استفاده از روی هم نشانی لایه های نقاط كوانتومي InAs با فواصل InGaAsP [21] استقاد المحمد الم شکل 1-26. طیف بهره تقویت کننده های نقطه کوانتومی. از بالا به پایین: 1-نقاط کوانتومی استاندارد SK 2-2 SK لایه از ﻧﻘﺎﻝ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻓﻮﺍﺻﻞ 2 ﺗﮏ ﻻﻳﻪ 3- 22 ﻻﻳﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻝ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻓﻮﺍﺻﻞ 2.5 ﺗﮏ ﻻﻳﻪ [22]................ شکل 1-27. نسبت بهره TM/TE بر حسب چگالی جریان و بر حسب نسبت وجوه در چگالی جریان 100 A/cm<sup>2</sup> 32......[28] شکل 1-2. ساختار باند هدایت نقاط کوانتومی. ثابت های زمانی نشان داده در شکل در ادامه گزارش محاسبه شده شكل 1-3. تغييرات بهره تقويت كننده با ورود پالس 40 ميلي وات به پهناي 10 پيكو ثانيه به ازاي جريانهاي متفاوت..... شکل 2-3. تغییرات بهره تقویت کننده با ورود پالس 40 میلی وات به پهنای 10 پیکو ثانیه به ازای جریانهای متفاوت که در مقاله گروه سوگاوارا آمده است [29]..... شکل 3-3. تغییرات بهره تقویت کننده در چگالی جریان 1 kA/cm<sup>2</sup> به ازای توان های ورودی متفاوت...... شکل 4-3. تغییرات بهره تقویت کننده در چگالی جریان 8 kA/cm<sup>2</sup> به ازای توان های ورودی متفاوت............ شكل6-3. خروجي برنامه در چگالي جريان 1 kA/cm<sup>2</sup> به ازاي تعداد تقسيمات متفاوت.......................... شکل7-3. بهره گروه های نقاط کوانتومی در چگالی جریان 1 kA/cm<sup>2</sup> به ازای پهن شدگی های غیر همگن متفاوت....51 شکل 8-3. بهره خروجی تقویت کننده در چگالی جریان 1 kA/cm<sup>2</sup> به ازای پهن شدگی های غیر همگن متفاوت......5 شکل 9-3- بهره خروجی تقویت کننده در چگالی جریان 8 kA/cm<sup>2</sup> به ازای پهن شدگی های غیر همگن متفاوت......53 شکل10-3. بهره خروجی تقویت کننده در چگالی جریان 1 kA/cm<sup>2</sup> به ازای پهن شدگی های همگن متفاوت.......... شکل11-3. احتمال پر بودن گروه های نقاط کوانتومی در مرکز تقویت کننده در چگالی جریان 16 kA/cm<sup>2</sup> ....... شکل 12-3 - تغییر بهره تقویت کننده برای سیگنال 1 mW در چگالی جریان 1 kA/cm<sup>2</sup> با تغییر چگالی نقاط كوانتومى ..... شکل 3-13 - تغییر بهره در جریان 1 kA/cm<sup>2</sup> و سیگنال 40 mW با تغییر تبهگنی تراز ها................................ شكل14-3 - افزايش بهره تقويت كننده در جريان 1 kA/cm<sup>2</sup> و سيگنال 40 mW با افزايش تبهگنی تراز يايه................ شكل 15-3 - مقايسه بهره براي يالس mW در چگالي جريان 1 kA/cm<sup>2</sup> براي دماهاي متفاوت................ شکل18-3. بهره تقویت کننده برای سیگنال پیوسته (خط ممتد) و پالس (خط چین) در عبور از یک جهت با توانهای 

ال پیوسته (خط ممتد) و پالس (خط چین) در عبور از یک جهت با توانهای	شکل 19-3. بهره تقویت کننده برای سیگن
66	
ل پیوسته (خط ممتد) و پالس (خط چین) در عبور از یک جهت با توانهای	شكل20-3. بهره تقويت كننده براى سيگنال
67	
ل پیوسته (خط ممتد) و پالس (خط چین) در عبور از یک جهت با توانهای	شکل 21-3. بهره تقویت کننده برای سیگنا
68	
کننده نقطه کوانتومی در شرایط شکل 21-3. در این شکل مفهوم XGM به	شکل 22-3. سیگنال های خروجی از تقویت
69	خوبی دیده می شود
عمال شده در جهت مخالف سیگنال پیوسته. شکل بهره پالس با شکل بهره در	شكل 23-3. بهره تقويت كننده براى پالس ا
	حالت انتشار در جهت یکسان کاملاً متفاوت ا
ئىكل 23-3	شکل 24-3. شکل پالس خروجی در شرایط م
های اعمال شده در جهت مخالف سیگنال پیوسته که انرژی فوتون آن برابر	شكل 25-3. بهره تقويت كننده براى پالس
کوانتومی است	انرژی رزونانس تراز پایه در گروه مرکزی نقاط
بالس ها در حالت اعمال دو پالس در جهت مخالف	شکل 26-3. بهره تقویت کننده برای یکی از
از تقویت کننده در حالت اعمال دو پالس در جهت ( $E_{photon} = E_{0cv} - 3 \; n$	شكل 27-3. شكل پالس خروجى دوم (neV
77	مخالف
رژی نسبتاً زیاد. تأثیر دو پالس بر روی یکدیگر کاهش یافته است	شکل 28-3. بهره برای دو پالس با اختلاف انر
ی تقویت کننده در ابتدای اعمال پالس ها	شکل 29-3. تخلیه نقاط کوانتومی در دو سوء
بانی تقویت کننده و در زمانهای میانی	شكل30-3. تخليه نقاط كوانتومى در نقطه مب
در دو سوی تقویت کننده در زمانهای پایانی	شكل 31-3. احتمال پر بودن نقاط كوانتومي
فوتون این پالس برابر انرژی رزونانس تراز پایه در گروه مرکزی در نظر گرفته	شكل 32-3. شكل خروجى پالس اول. انرژى
ترون-ولت کمتر در نظر گرفته شده است	شده است. انرژی فوتون پالس دوم 3 میلی اک
يط شكل 32-3-	شکل 33-3. شکل خروجی پالس دوم در شرا
11 پیکو ثانیه اختلاف زمانی با پالس اول به تقویت کننده وارد شده است82	شکل 34-3. شکل خروجی پالس دوم که با (
1 mV که پس از خروج پالس 40 میلی واتی به تقویت کننده اعمال شده	شكل 35-3. شكل پالس خروجي با توان ۷
83	است

# فهرست جداول

. درجه آزادی حامل ها در سیستم های مختلف ادوات نوری	جدول 1-1
. مقادیر و توضیحات پارامتر های برنامه	جدول 1-2

# فصل 1 - مروری بر تحقیقات انجام شده در تقویت کننده های نوری نقطه کوانتومی

#### 1-1- مقدمه

این حقیقت که کاهش ابعاد حرکت الکترونها و حفره ها در اثر محدود کردن آنها، به تولید افزاره های بهتر می انجامد در الکترونیک نوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. این عمل اولین بار با محدود کردن حامل های بار در یک نوار نازک نیمه هادی با گاف انرژی<sup>1</sup> کوچک تر در میان یک نیمه هادی با گاف انرژی وازی بار کوچک تر در میان یک نیمه هادی با گاف انرژی وازی بار کوچک تر در میان یک نیمه هادی با گاف انرژی ان کوچک تر در میان یک نیمه هادی با گاف انرژی ان کوچک تر در میان یک نیمه هادی با محدود کردن حامل های بار در یک نوار نازک نیمه هادی با گاف انرژی ان کوچک تر در میان یک نیمه هادی با افزی بار به تولید گاف انرژی بزرگتر انجام گرفت. به کار گیری این ساختار که چاه کوانتومی<sup>2</sup> نامیده شد منجر به تولید ادوات نوری با مشخصه های بهتر شد. پس از آن محدود سازی ابعاد حرکت حامل های بار با تولید سیم های کوانتومی<sup>3</sup> و در نهایت نقطه های کوانتومی<sup>4</sup> ادامه یافت.

در یک چاه کوانتومی حرکت حامل ها در یک بعد محدود شده است و درجه آزادی آنها برابر 2 است. این در حالیست که در سیم کوانتومی با اعمال محدودیت در دو بعد، درجه آزادی حامل ها به یک بعد کاهش یافته است. در نقطه های کوانتومی حرکت حامل ها در هر سه بعد محدود شده و درجه آزادی برابر صفر است. جدول 1 انواع ساختار های نیمه هادی ها را بر اساس درجه محدودیت و آزادی طبقه بندی می کند. همان طور که انتظار داریم مجموع درجه محدودیت و درجه آزادی در همه ساختار ها برابر 3 است. شکل 1-1 نمای ساده ای از یک چاه کوانتومی و یک سیم کوانتومی را نشان می دهد. گاف انرژی نیمه هادی سفید رنگ از گاف انرژی نیمه هادی تیره رنگ کوچکتر است. در شکل 2-1 به وضوح نشان داده شده است که درجه آزادی حرکت حامل ها در سیم های کوانتومی برابر یک است (در اینجا در جهت y).

$$E = \frac{h^2 k^2}{2m^*}$$
(1-1)

<sup>1</sup> - Band Gap

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Quantum Well

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Quantum Wire

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - Quantum Dot

سيستم	درجه محدوديت	درجه آزادی
بدنه 1	0	3
چاه کوانتومی	1	2
سیم کوانتومی	2	1
نقطه كوانتومى	3	0

جدول 1-1. درجه آزادی حامل ها در سیستم های مختلف ادوات نوری

همان طور که اشاره کردیم در نقطه های کوانتومی حرکت حامل ها در هر سه بعد محدود شده است. شکل 3-1 نمای ساده ای از یک نقطه کوانتومی را نشان می دهد. همان طور که می بینیم حامل بار از هر سه جهت کاملاً محدود شده و درجه آزادی برابر صفر است.



شکل 1-1. نمای ساده ای از چاه کوانتومی (سمت چپ) و سیم کوانتومی (سمت راست)

### 1-2- رشد نقاط كوانتومي

رشد Heteroepitaxial نیمه هادیها (رشد یک نیمه هادی روی یک نیمه هادی متفاوت) همان طور که در شکل 1-4 نمایش داده شده است در سه نوع مختلف اتفاق می افتد. نوع اول عبارت است از رشد لایه به لایه یا رشد Frank-van der Merwe که اختصاراً روش FM نامیده می شود. نوع دوم عبارت

<sup>1</sup> - Bulk

است از رشد جزیره ای یا روش Volmer-Weber که اختصاراً روش VW نامیده می شود و در نهایت نوع سوم عبارت است از رشد لایه لایه همراه با رشد جزیره ای یا رشد Stranski-Krastanov که اختصاراً روش SK خوانده می شود. نوع رشد حاصله متأثر از انرژی های سطوح و تفاوت ثوابت شبکه های لایه اپی $^{1}$ و زیرلایه $^{2}$ است [1،2]. به بیان ساده، رشد لایه به لایه یا  $\mathrm{FM}$  وقتی اتفاق می افتد که



شکل 2-1. درجه آزادی حرکت حامل ها در سیم های کوانتومی برابر یک است.



شکل 3-1. نمای ساده ای از یک نقطه کوانتومی. درجه آزادی حرکت حامل ها برابر صفر است.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Epilayer <sup>2</sup> - Substrate

شبکه زیرلایه و شبکه اپی بایکدیگر تطابق داشته باشند. در صورتی که این دو شبکه با یکدیگر بسیار متفاوت باشند شرایط برای رشد لایه به لایه فراهم نبوده و لایه اپی روی زیر لایه به جزایر جداگانه تقسیم می شود و در واقع مدل رشد دوم یعنی رشد WW اتفاق می افتد. رشد SK وقتی اتفاق می افتد که دو شبکه با یکدیگر یکسان نیستند اما تفاوت آنها نسبت به حالت دوم کمتر است. در این حالت لایه اپی تا شبکه با یکدیگر یکسان نیستند اما تفاوت آنها نسبت به حالت دوم کمتر است. در این حالت لایه اپی تا شبکه با یکدیگر یکسان نیستند اما تفاوت آنها نسبت به حالت دوم کمتر است. در این حالت لایه اپی تا چند تک لایه روی زیر لایه می نشیند اما پس از آن به دلیل بالا رفتن فشار<sup>1</sup> مانند حالت دوم به جزایر مجزا تقسیم می شود. به این مدل رشد، رشد خود سامانی<sup>2</sup> می گویند چرا که جزایر یا همان نقاط کوانتومی به صورت خود به خودی سامان می یابند. شکل 4-1 نمونه ای از یک دیاگرام فازی برای شرایط مورد نیاز برای حصول هر کدام از سه نوع رشد ذکر شده را نشان می دهد. این دیاگرام نشان می دهد که مورد نیاز برای حصول هر کدام از سه نوع رشد ذکر شده را نشان می دهد. این دیاگرام نشان می دهد که مورد نیاز برای حصول هر کدام از سه نوع رشد ذکر شده را نشان می دهد. این دیاگرام نشان می دهد که مورد نیاز برای حصول هر کدام از سه نوع رشد ذکر شده را نشان می دهد. این دیاگرام نشان می دهد که مورد نیاز برای حصول هر کدام از سه نوع رشد ذکر شده ای نشان می دهد. این دیاگرام نشان می دهد که مورد نیاز برای حصول هر کدام از سه نوع رشد ذکر شده را نشان می دهد. این دیاگرام نشان می دهد که مورد نیاز برای حصول هر کدام از سه نوع رشد ذکر شده را نشان می دهد. این دیاگرام نشان می دهد که مورد نیاز برای حصول هر کدام از سه نوع رشد ذکر شده را نشان می دهد. این دیاگرام نشان می دهد که مورد نیاز برای معلوم و معین جزایر خود سامان شده نقاط کوانتومی تشکیل خواهند شد (نواحی SK1 و این مرایط مر کران مرایم مرای مرایم مرورتی که در نواحی ایم ای شده نقاط کوانتومی هر گز تشکیل نخواهند شد و یا نقاط تشکیل شده متراکم نخواهند بود.



شکل 4-1. نمای ساده ای از سه مدل رشد FM، FM و SK (سمت چپ) و دیاگرام فازی آنها. محور افقی بر حسب عدم تطابق شبکه و محور عمودی تعداد تک لایه های نشانده شده است. در نواحی R1، R2 و R3 همان طور که در اشکال داخلی نشان داده شده است رشد جزایر نایایدار است و از نظم خاصی پیروی نمی کند [1].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Strain

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Self Assembly

آنچه در طول روند تشکیل نقاط کوانتومی در روش SK اتفاق می افتد به این قرار است که ابتدا رشد لایه اپی در روش FM آغاز می شود. در این حالت در واقع لایه اپی به صورت مسطح روی زیر لایه می نشیند و اصطلاحاً زیر لایه را خیس می کند. اما این شرایط چندان دوام نمی آورد و در واقع پس ار نشستن تنها چند تک لایه فشار روی لایه اپی بالا می رود و اتمها برای آزاد کردن این فشار در جزایر جداگانه گرد هم می آیند و تشکیل نقاط کوانتومی می دهند. نتیجه نهایی عبارت است از مجموعه ای از نقاط کوانتومی که بر روی یک لایه خیس کننده یا همان Rayer تشکیل شده اند. نقاط کوانتومی تشکیل شده در این روش معمولاً هرمی شکل بوده و دارای ابعاد عرضی بین 15 تا 30 نانومتر و ارتفاع 3 تا 10 نانومتر هستند. چگالی سطحی این نقاط نیز بین <sup>8</sup>0 تا <sup>11</sup>10 نقطه در سانتی متر مربع متغیر است. اندازه نقاط کوانتومی با کنترل مقدار ماده لایه نشانی شده، کنترل ترکیب ماده لایه نشانی شده (که میزان فشار را تعیین می کند)، و تغییر شرایط رشد مانند دما و زمان رشد در بازه محدودی قابل کنترل است.

مشخصه دیگری که در تولید ادوات مبتنی بر نقاط کوانتومی اهمیت به سزایی دارد توزیع اندازه نقاط است که تعیین کننده همگن بودن خواص الکترونیکی آنهاست. پهن شدگی در تابع توزیع اندازه نقاط کوانتومی از خصوصیات غیر قابل اجتناب نقاط تولید شده در فرآیند خود سامانی است اما میزان این پهن شدگی وابسته به شرایط رشد است. بنابر این چالش موجود در رشد دادن نقاط کوانتومی عبارت است از فراهم کردن پارامتر های مناسب برای لایه اپی و شرایط رشد به گونه ای که ابعاد نقاط کوانتومی، چگالی سطحی آنها و پهن شدگی اندازه آنها به میزان مطلوب باشد. شکل 5-1 تصاویر <sup>1</sup>MET نمونه ای از نقاط کوانتومی از جنس InP را نشان می دهد که به روش SK روی زیر لایه GaAS نشانده شده اند [3]. این شکل نشان می دهد که چگونه شرایط رشد نقاط بر روی اندازه و چگالی سطحی آنها مؤثر است. روش SK را می توان همچنین برای تولید نقاط کوانتومی InGaAS روی GaAS روی آم ای می دو آ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Transmission Electron Microscopy



شکل 5-1. تصاویر TEM از بالا (سمت چپ) و از کنار (سمت راست) نقاط کوانتومی InP روی GaAs. نقاط ردیف بالایی در 500 درجه سانتی گراد رشد داده شده و روی آنها پوشانده شده است در حالیکه نقاط ردیف پایین پس از رشد در 500 درجه سانتی گراد به مدت 120 ثانیه در 450 درجه نگاه داشته شده و در همین دما پوشانده شده اند [3]. و نقاط InF روی InGaAsP به کار گرفت. مسئله ای که روش SK را برای تولید نقاط کوانتومی بسیار جذاب می کند این است که این روش با تکنیک های سنتی مانند MBE<sup>1</sup>، MOCVD<sup>2</sup> و یا CBE<sup>3</sup> با استفاده از دستگاه های سنتی رشد امکان پذیر است. مزایای دیگر این روش عبارتند از:

- 1- روش SK یک روش بدون ماسک است و بی نیاز از فرآیند های پیچیده فوتولیتو گرافی است.
  2- در این روش، رشد چگالی بالایی از نقاط کوانتومی با یکنواختی مناسبی از نظر اندازه و ترکیب نقاط تنها در یک مرحله لایه نشانی امکان پذیر است.
- 3- بعد از رشد نقاط کوانتومی، لایه نشانی ماده زیر لایه به آسانی امکان پذیر است. این مزیت امکان تولید ادوات متنوع نوری جهت افزایش تعامل با نور موجود در افزاره را به دست می دهد.

### 1-3-1 ساختار الكترونيكي نقاط كوانتومي

ساختار الکترونیکی نقاط کوانتومی که تعیین کننده چگونگی تعامل کوانتوم الکترونیکی این نقاط با نور است با توجه به توزیع فضایی پتانسیل محدود کننده حامل ها تعیین می شود. ماده سازنده نقاط

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Molecular Beam Epitaxy

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Metal Organic Chemical Vapor Deposition

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Chemical Beam Epitaxy